

Portableas Circular De Ptfе De 6 Pulgadas, Cesta De Limpieza Semiconductora Resistente A Ácidos Y Álcalis, Personalizable

Número de artículo: PL-CP207



Introducción

Portableas circulares de PTFE de alta pureza de 6 pulgadas diseñados para la limpieza de semiconductores. Excelente resistencia a ácidos y álcalis para grabado con piraña y HF. Las cestas de mecanizado de precisión, totalmente personalizables, garantizan una manipulación segura de sustratos durante procesos químicos húmedos exigentes, baños de inmersión y enjuague ultrasónico.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Ventaja principal
Proceso de limpieza RCA	Se utiliza para eliminar residuos orgánicos, capas finas de óxido y contaminación iónica de obleas de silicio mediante soluciones SC-1 y SC-2.	La alta resistencia térmica y química evita la degradación del portador durante la inmersión en baño calentado.
Grabado con piraña	Manipulación de obleas en una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno para eliminar materia orgánica pesada.	La resistencia excepcional a entornos oxidativos agresivos garantiza una larga vida útil del equipo.
Baños de ácido hidrofluorico (HF)	Eliminación de capas de óxido sacrificio u óxidos nativos de superficies de silicio en concentraciones variables de HF.	La pureza del material evita la introducción de iones metálicos en el entorno de grabado sensible.
Enjuague post-CMP	Transporte de obleas a través de ciclos de limpieza después del pulido químico-mecánico para eliminar partículas de suspensión.	Las superficies lisas y antiadherentes evitan la retención de partículas y facilitan una limpieza ultrasónica efectiva.
Fabricación de células solares	Procesamiento de obleas de silicio monocristalino o policristalino de 6 pulgadas durante los pasos de texturizado y difusión de fósforo.	La construcción robusta soporta un alto volumen de producción en líneas de producción industriales exigentes.
Fotolitografía	Soporte de sustratos durante el revelado y eliminación de fotorresina mediante solventes y removedores especializados.	La compatibilidad universal con solventes evita el hinchamiento o ablandamiento del marco del portador.
Limpieza ultrasónica	Transporte de componentes delicados en baños ultrasónicos o megasonicos para eliminación de contaminantes de alta precisión.	La rigidez estructural permite una transmisión eficiente de energía acústica a las superficies de las obleas.
Grabado de semiconductores compuestos	Procesamiento de obleas de GaAs, InP o SiC en mezclas químicas especializadas para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos.	La geometría de ranura personalizable se adapta a diferentes espesores de oblea y materiales de sustrato frágiles.

Parámetro	Detalle de especificación para PL-CP207
Identificador de modelo	PL-CP207
Construcción de material	PTFE virgen de alta pureza (opciones personalizadas de PFA disponibles)
Compatibilidad con tamaño de oblea	Diámetro de 6 pulgadas / 150 mm
Configuración de geometría	Cesta de limpieza circular / Tipo cesta de flores
Compatibilidad química	Resistencia universal (Ácidos, bases, solventes, oxidantes)
Tolerancia a la temperatura	Adecuado para procesamiento criogénico a alta temperatura

Aplicación	Descripción	Ventaja principal
Parámetro	Detalle de especificación para PL-CP207	
Capacidad de personalización	Dimensiones, cantidad de ranuras y configuraciones de manillar totalmente personalizables	
Acabado superficial	Mecanizado de precisión, ultra liso, no poroso	
Capacidad de lote	Diseño personalizado según los requisitos específicos de cantidad de obleas del cliente	
Método de fabricación	Mecanizado CNC a medida / Fabricación personalizada	